## Гетеропереход на полупроводниках с цепочечной структурой TISe-TIInSe<sub>2</sub>

© И.В. Алексеев

Объединенный институт ядерных исследований, 141980 Дубна, Россия

(Получена 16 июня 1997 г. Принята к печати 11 ноября 1997 г.)

Получен гетеропереход на основе полупроводников с цепочечной кристаллической структурой p-TISe-p-TIInSe<sub>2</sub>. Для получения использован метод жидкофазной эпитаксии из расплава TISe на поверхности естественного скола (110) кристалла TIInSe<sub>2</sub>. Полученная структура обладаает чувствительностью к свету и жесткой радиации. Исследованы некоторые фотоэлектрические свойства гетеропереходов.

Известно, что одним из факторов, стимулировавших разработку гетеропереходов в полупроводниках  $A^{II}B^{VI}$  была невозможность создания p-n-гетероперехода во многих соединениях этой группы вследствие явления самокомпенсации, затрудняющего их легирование [1,2].

С похожей ситуацией сталкиваемся в анизотропных. например, слоистых полупроводниках, легирование которых осложняется эффектом "самоочистки" — выделением примеси из слоев в межслоевое пространство кристалла [3]. С другой стороны, анизотропность слоистых полупроводников позволяет получать путем их расслаивания совершенные естественные поверхности с низкой плотностью состояний, что важно для достижения высокого качества гетеропереходов (ГП). Работы по созданию ГП в слоистых кристаллах методом ван-дер-ваальсовой эпитаксии интенсивно ведутся в последнее время, в частности, на таких полупроводниках, как InSe, GaSe [4,5]. Представляется интересным исследовать в данном направлении другой класс анизотропных полупроводников — с цепочечной структурой.

Параметры кристаллов

Соединение	a, Å	c, Å	$E_g$ , эВ	$T_m$ , °C	Источник
TlSe	$8.02 \pm 0.01$	$7.00 \pm 0.02$	0.56	334	[6,7]
$TlInSe_2$	8.075(3)	6.847(4)			[7]
$TlInSe_2$	8.02	6.826	1.2	772	[8]

*Примечание.* a, c — постоянные кристаллической решетки,  $E_g$  — ширина запрещенной зоны,  $T_m$  — температура плавления.

Интересными представителями таких полупроводников являются TISe и TIInSe<sub>2</sub>. Они изоструктурны, кристаллизуются в тетрагональной решетке. Некоторые параметры кристаллов приведены в таблице. В отличие от соединений  $A^{III}B^{IV}C^V$  с цепочечной кристаллической структурой для них существует хорошо отработанная технология выращивания крупных монокристаллов [9]. Кристаллы  $TIInSe_2$  обладают высокой чувствительностью к ближнему инфракрасному излучению, к жеской радиации, проявляют высокую радиационную стойкость [10]. В настоящей работе приведены первые результаты по изготовлению методом ван-дер-ваальсовой

эпитаксии гетеропереходов TISe-TIInSe<sub>2</sub>. Эпитаксия TISe на поверхности (110) TIInSe<sub>2</sub> осуществлялась из расплава TISe при непосредственом контакте расплава с подложкой.

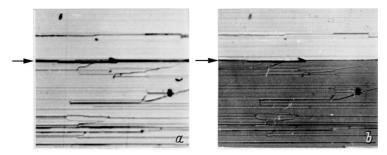
Кристаллы для эксперимента выращивались методом ориентированной кристаллизации, описанным в [9] и представляющим собой модифицированный метод Бриджмена. Выращенные монокристаллические слитки имели кристаллографическую ориентацию с осью  $\mathbf{c}$ , направленной вдоль слитка, проводимость p-типа и концентрацию дырок при 290 К  $1.7 \cdot 10^{17}$  и  $2.1 \cdot 10^{11}$  см $^{-3}$  для TISe и TIInSe2 соответственно.

Подложки подготавливались раскалыванием слитка по двум взаимо перпендикулярным плоскостям  $\{110\}$  естественного скола, имели форму стержней прямоугольного сечения с примерными размерами  $0.5 \times 2 \times 10 \,\mathrm{mm}^3$ . Зеркальные плоскости, ограничивающие образцы, не подвергались дополнительной обработке.

Изготовление гетероструктур проводилось в горизонтальной кварцевой трубе в вакууме при остаточном давлении 0.13 Па. Два малоинерционных нагревателя обеспечивали в реакторе вертикальный градиент температуры.

При подготовке к процедуре эпитаксии применяли два варианта взаиморасположения TISe и подложки: TISe снизу и сверху подложки. В первом варианте подложку укладывали свежесколотой поверхностью на кристалл или порошок TISe, загруженные в тонкостенную кварцевую "лодочку". Во втором варианте на подложке располагали образец TISe с размерами, чуть меньшими размеров подложки. Далее температуру в реакторе поднимали до расплавления TISe за  $7 \div 10$  мин, фиксировали на  $3 \div 5$  мин, после чего быстро, за  $30\,$ с, снижали на  $10 \div 15^{\circ}$  С. Дальнейшее снижение температуры проводили со скоростью  $3 \div 4^{\circ}$  С/мин.

В обоих вариантах эпитаксиальные слои получались монокристаллическими в случаях, когда температура подложки была ниже температуры расплава. Однако в первом варианте при этом эпитаксиальные слои оказывались пронизанными мелкими порами, по-видимому, вследствие перегрева нижних слоев расплава и выделения летучей компоненты. Толщина эпитаксиальных слоев составляла  $100 \div 200$  мкм.



**Рис. 1.** Микрофотография поверхности бокового скола гетероструктуры в естественном (a) и поляризованном (b) свете. Увеличение  $\times 250$ .

На приготовление гетероструктуры наносились напаиванием омические контакты из индия, сплошные со стороны TISe и в виде узкой продольной полоски с противоположной. На рис. 1 представлена микрофотография поверхности бокового скола гетероструктуры, произведенного в плоскости (110) перпендикулярно границе перехода. В верхней части — эпитаксиальный слой TISe. Обозначенное стрелками сечение границы перехода ясно различается в поляризованном свете.

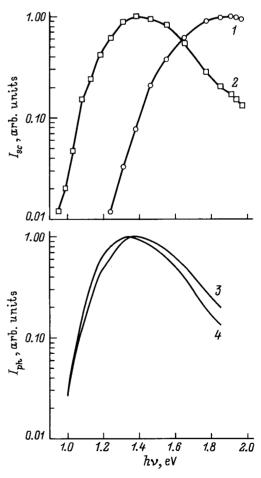
Полученные изотипные ГП обладали заметной чувствительностью к свету и жесткой радиации. Вольтамперные характеристики были почти симметричными с коэффициентом выпрямления  $1.5 \div 2$  при напряжении 0.5 В. Токи при этом составляли несколько десятых мкА. Ввиду значительной величины последовательного сопротивления, определяющегося высокоомной подложкой, анализ вольт-амперных и вольт-емкостных характеристик не представлял интереса.

Максимальное значение плотности тока короткого замыкания (освещение со стороны  $TIInSe_2$ ) составляло  $I_{sc}=0.5\div0.6\,\mathrm{mA/cm^2}$ . Напряжение холостого хода  $U_{oc}$  при концентрированном солнечном освещении достигало  $0.39\div0.40\,\mathrm{B}$  при комнатной температуре. Полярность фотоответа на всех ГП соответствовала положительному потенциалу TISe относительно  $TIInSe_2$ .

Токи, возбуждаемые рентгеновским излучением с энергией  $80 \div 100$  кэВ, составляли примерно 0.5 мкА при мощности экспозиционной дозы 10 р/мин.

На рис. 2 представлена спектральная характеристика фотоответа  $\Gamma\Pi$ , снятая в режиме тока короткого замыкания (кривая I). Из спектра видно, что в фотоответе не участвуют носители, генерируемые светом в узкозонной компоненте пары. Это может быть связано, в частности, с тем, что из-за большого различия в концентрации основных носителей в TISe и TIInSe2 область пространственного заряда сосредоточена в последнем. Обращает на себя внимание то, что максимум в спектральной характеристике  $\Gamma\Pi$  сдвинут относительно максимума в спектре фотопроводимости  $I_{\rm ph}$  однородного кристалла  $TIInSe_2$  (кривые 3 и 4) в коротковолновую сторону. Наблюдаемый сдвиг предположительно связываем с эффектом Дембера, так как в использованных высокоомных кристаллах  $TIInSe_2$  с большим значением

 $\mu_p \tau_p = 10^{-2} \, \mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{B}^{-1}$  ( $\mu_p$  — подвижность,  $\tau_p$  — время жизни дырок) должен быть значительным вклад в фотоответ диффузионного дырочного тока, направленного от освещаемой поверхности в сторону ГП. Данное предположение подтверждается также и тем, что при освещении вдоль гетероперехода, осуществляемом через боковой скол гетероструктуры, этого сдвига не обнаружено (рис. 2, кривая 2). Кривые 3 и 4 на рис. 2



**Рис. 2.** Спектры  $I_{sc}$  гетероперехода при освещении со стороны TlInSe<sub>2</sub> (1), через поверхность бокового скола вдоль границы перехода (2) и спектры фотопроводимости кристалла TlInSe<sub>2</sub> при освещении вдоль (3) и поперек (4) электрического поля.

590 И.В. Алексеев

представляют спектры фотопроводимости однородного кристалла  $TIInSe_2$  при освещении вдоль и поперек электрического поля соответственно. Напряженность поля в образцах составляла при этом 100~B/cm, и, следовательно, диффузионная компонента фотоответа по сравнению с фототоком не могла быть существенной. По этой причине сдвиг в спектрах фотопроводимости незначителен по сравнению с соответствующим сдвигом в спектрах  $I_{sc}$ . Подчеркнем, однако, что вывод о роли эффекта Дембера здесь носит предположительный характер.

Оценивались временные параметры полученных гетеропереходов по кинетике напряжения холостого хода, возбуждаемого прямоугольными импульсами излучения инжекционного лазера с длиной волны  $\lambda=0.91\,\mathrm{Mkm}$ . Постоянные нарастания и спада фотоответа составляли  $10^{-4}$  с. Большое значение времени отклика определяется *RC* ГП. Отметим, что соответствующие времена для детектора на основе однородного кристалла  $TIInSe_2$ , определяемые генерационно-рекомбинационными процессами в  $TIInSe_2$ , на 2 порядка больше.

Специальные исследования показали, что в TISe и  $TIInSe_2$  избыток и дефицит металлической компоненты не меняет типа проводимости, а избыточный селен образует в них мелкий акцептор. Учитывая при этом относительно низкую температуру эпитаксии и сходный состав материалов пары, можно предположить, что перекрестное легирование и образование паразитных p-n-переходов при формировании  $\Gamma\Pi$  маловероятны.

Близость параметров кристаллической решетки и естественная поверхность кристаллов, образующих гетерограницу, позволяют надеяться на возможность реализации в данной системе ГП с низкой плотностью локальных состояний на границе.

Использование низкоомного подложечного материала и отработка технологии изготовления позволят подробнее исследовать ГП и улучшить его характеристики — расширить область спектральной чувствительности, увеличить  $I_{sc}$ , уменьшить время отклика и т. д. В этом случае ГП TISe—TIInSe2 могут найти применение в качестве детекторов жесткой радиации, радиационно-стойких солнечных элементов.

## Список литературы

- [1] Х.Х. Вудбери, В кн.: Физика и химия соединений  $A^3B^6$ , пер. с англ. под ред. С.А. Медведева (М., Мир, 1970).
- [2] R.W. Dutton, R.S. Muller. Sol. St. Electron., 11, 749 (1968).
- [3] К.Д. Товстюк. Полупроводниковое материаловедение (Киев, Наук. думка, 1984).
- [4] O. Lang, A. Klein. J. Cryst. Growth, 146, 439 (1995).
- [5] O. Lang, C. Peterkoffer at al. In: Proc. 13th Photovoltaic Conference (Nizza, 1995).
- [6] Физико-химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник (М., Наука, 1979).
- [7] D. Muller, G. Eulenberger, H. Hahn. Z. Anorg. Allg. Chem., 398, 207 (1973).

- [8] G.D. Guseinov, E. Mooser, I.V. Alekseev al al. Phys. St. Sol., 34, 33 (1969).
- [9] И.В. Алексеев. Изв. АН СССР. Неорг. матер., **26**, 1401 (1990).
- [10] И.В. Алексеев. Изв. АН СССР. Неорг. матер., 28, 2404 (1992).

Редактор Л.В. Шаронова

## A heterojunction on TISe-TIInSe<sub>2</sub> chain structure semiconductors

A.V. Alekseev

Joint Institute for Nuclear Research, 141980 Dubna. Russia

e-mail: aleks@nf.jinr.ru